Docket No. 1232-5100



pplicant(s):

Masaki UNAGAMI

TBA Group Art Unit:

Serial No.:

10/634,435

Examiner:

TBA

Filed:

August 5, 2003

For:

METHOD AND ASSEMBLY FOR STATIC ELIMINATION OF CLEANING

OBJECT IN CLEANING APPARATUS

CERTIFICATE OF MAILING (37 C.F.R. §1.8(a))

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

I hereby certify that the attached:

- Claim to Convention Priority w/Document; and
- Return Receipt postcard 2.

3.

along with any paper(s) referred to as being attached or enclosed and this Certificate of Mailing are being deposited with the United States Postal Service on date shown below with sufficient postage as first-class mail in an envelope addressed to the: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

> Respectfully submitted, MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

Dated: October 3, 2003

By:

Correspondence Address:

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P. 345 Park Avenue New York, NY 10154-0053 (212) 758-4800 Telephone (212) 751-6849 Facsimile



Docket No.: 1232-5100

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s):

Masaki UNAGAMI

Group Art Unit:

TBA

Serial No.:

10/634,435

Examiner:

TBA

Filed:

August 5, 2003

For:

METHOD AND ASSEMBLY FOR STATIC ELIMINATION OF CLEANING

OBJECT IN CLEANING APPARATUS

CLAIM TO CONVENTION PRIORITY

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In the matter of the above-identified application and under the provisions of 35 U.S.C. §119 and 37 C.F.R. §1.55, applicant(s) claim(s) the benefit of the following prior application(s):

Application(s) filed in:

Japan

In the name of:

Canon Kabushiki Kaisha

Serial No(s):

2002-229380

Filing Date(s):

August 7, 2002

\boxtimes	Pursuant to the Claim to Priority, applicant(s) submit(s) a duly certified copy of said foreign application.
	A duly certified copy of said foreign application is in the file of application Serial No, filed

Respectfully submitted,

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

Dated: October 3, 2003

By:

Joseph A. Calvaruso Registration No. 28,287

Correspondence Address:

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P. 345 Park Avenue New York, NY 10154-0053 (212) 758-4800 Telephone (212) 751-6849 Facsimile

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月 7日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-229380

[ST. 10/C]:

[1P2002-229380]

出 願 人

キヤノン株式会社

Applicant(s):

2003年 8月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

4631103

【提出日】

平成14年 8月 7日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H05K 3/26

H05F 3/02

【発明の名称】

乾式ブラスト洗浄における被洗浄物の除電方法および装

置

【請求項の数】

4

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

海上 雅毅

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【氏名又は名称】

キヤノン株式会社

【代表者】

御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】

100095991

【弁理士】

【氏名又は名称】

阪本 善朗

【電話番号】

03-5685-6311

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

020330

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9704673

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 乾式ブラスト洗浄における被洗浄物の除電方法および装置 【特許請求の範囲】

【請求項1】 乾式ブラスト洗浄中の被洗浄物に対して、前記被洗浄物の複数の部位に、それぞれ軸方向に移動自在であってかつ接地された導電性を有するピンを多点接触させることにより、前記被洗浄物に発生する静電気を除去することを特徴とする、乾式ブラスト洗浄における被洗浄物の除電方法。

【請求項2】 被洗浄物を保持する保持手段と、接地された導電性を有する 基盤および前記基盤にそれぞれ可動機構を介して軸方向に移動自在に配設された 複数の導電性を有するピンを備えた除電ブロックと、前記除電ブロックを前記保 持手段に保持された前記被洗浄物に対して前進および後退させる接触機構とを有 しており、前記接触機構によって前記除電ブロックを前進させて前記ピンを前記 被洗浄物に多点接触させて前記被洗浄物に発生する静電気を除去するように構成 されたことを特徴とする、乾式ブラスト洗浄における被洗浄物の除電装置。

【請求項3】 複数の導電性を有するピンは、それぞれ独立して軸方向に移動自在であり、被洗浄物の凹凸部に対応して軸方向へ移動して前記被洗浄物に接触するように構成されたことを特徴とする、請求項2記載の乾式ブラスト洗浄における被洗浄物の除電装置。

【請求項4】 各可動機構は、導電性を有するピンを所定の接触圧力で被洗 浄物に接触させる緩衝手段を有することを特徴とする、請求項3記載の乾式ブラ スト洗浄における被洗浄物の除電装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、電子機器等の被洗浄物の乾式ブラスト洗浄中に被洗浄物に発生する 静電気を除去する被洗浄物の除電方法および装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来、静電気に対して脆弱な電子機器等の被洗浄物を乾式ブラスト洗浄する際

に、被洗浄物に発生する静電気による静電気破壊を防止する方法として、被洗浄物に界面活性剤をコーティングして、静電気の帯電を抑制する方法が用いられている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

上記従来の技術では、被洗浄物に界面活性剤をコーティングする界面活性剤コーティング工程が必要であることと、被洗浄物の洗浄後の電気特性への影響等を 考慮して界面活性剤の種類を選択する必要があり、洗浄対象物が限定されるという未解決の課題があった。

[0004]

本発明は、上記従来の技術の有する未解決の課題に鑑みてなされたものであって、電子機器等の広範にわたる被洗浄物の乾式ブラスト洗浄にあたり、被洗浄物に発生する静電気を簡単かつ確実に除去することができる、乾式ブラスト洗浄における被洗浄物の除電方法および装置を提供することを目的とするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明の乾式ブラスト洗浄における被洗浄物の除電 方法は、乾式ブラスト洗浄中の被洗浄物に対して、前記被洗浄物の複数の部位に 、それぞれ軸方向に移動自在であってかつ接地された導電性を有するピンを多点 接触させることにより、前記被洗浄物に発生する静電気を除去することを特徴と するものである。

[0006]

本発明の乾式ブラスト洗浄における被洗浄物の除電装置は、被洗浄物を保持する保持手段と、接地された導電性を有する基盤および前記基盤にそれぞれ可動機構を介して軸方向に移動自在に配設された複数の導電性を有するピンを備えた除電ブロックと、前記除電ブロックを前記保持手段に保持された前記被洗浄物に対して前進および後退させる接触機構とを有しており、前記接触機構によって前記除電ブロックを前進させて前記ピンを前記被洗浄物に多点接触させて前記被洗浄物に発生する静電気を除去するように構成されたことを特徴とするものである。

[0007]

また、複数の導電性を有するピンは、それぞれ独立して軸方向に移動自在であり、被洗浄物の凹凸部に対応して軸方向へ移動して前記被洗浄物に接触するように構成されたものとする。

[0008]

さらに、各可動機構は、導電性を有するピンを所定の接触圧力で被洗浄物に接 触させる緩衝手段を有するものとする。

[0009]

【作用】

乾式ブラスト洗浄中に、洗浄中の被洗浄物の複数の部位に、それぞれ接地された は事電性を有するピンを当接させることにより、被洗浄物に発生する静電気を確 実に除去することができる。

[0010]

【発明の実施の形態】

先ず、一実施の形態による乾式ブラスト洗浄における被洗浄物の除電装置について説明する。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

図1の(a)、(b)に示すように、電子機器等の被洗浄物W(例えば、プリント配線板)を保持する保持手段である一対の保持部材10と、導電性を有する基盤1および基盤1に互いに間隔をおいて配設された複数の導電性を有するピン2を備えた除電ブロックEと、除電ブロックEを保持部材10に保持された被洗浄物Wに対して前進および後退させる接触機構13等を有している。

[0012]

一対の保持部材10は、固定枠11の一端側に互いに対向して突設されており、被洗浄物Wの両側縁部を先端に設けられた溝状部7aに嵌合させて保持できるように構成されている。

[0013]

除電ブロックEは、アース線12を介して接地された導電性を有する基盤1と 、基盤1に互いに間隔をおいて設けられた複数の貫通孔1aと、各貫通孔1aに それぞれ軸方向へ移動自在に嵌挿された導電性を有するピン2とを備えている。 各ピン2には、一端に弾力性を有する導電性ゴム等からなる接点3が一体的に設けられているとともに、他端に抜け止め用のストッパ4が一体的に設けられており、基盤1とピン2の長手方向略中間部位に設けられた鍔状部10との間に緩衝手段としてのスプリング6を介在させることにより、常にストッパ4が基盤1の反被洗浄物側の面に当接した状態で待機するように付勢されている。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

そして、除電ブロックEは、基盤1の周辺部近傍部位(例えば4隅近傍部位)に設けられたガイド孔1aに嵌挿された先端にストッパaを有するガイド部材7に案内されて、保持部材10に保持された被洗浄物Wに対して進退自在であるとともに、基盤1と保持部材10との間に介在されたスプリング8の弾発力によって常時付勢されてピン2の先端が被洗浄物Wから離間した後退位置で待機するように構成されている。

[0015]

接触機構13は固定枠11の他端側に配設されており、操作レバー14を図1の(a)に示す位置から図2に示す位置に回動させることにより、操作レバー14に連動する図示しないカム機構やリンク機構等により移動枠9を介して除電ブロックEを被洗浄物Wに対して前進(図示矢印方向へ移動)させて各ピン2の接点3を弾力的に当接させることができるように構成されている。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

なお、本発明において、接触機構は、上記一実施の形態に示した操作レバー1 4に連動するカム機構やリンク機構等を有する接触機構13に限らず、油圧また は空気圧等の加圧流体で作動される流体圧シリンダや電動シリンダ等の直線駆動 手段を用いることができる。

[0017]

また、各ピン2の可動機構は、上記一実施の形態に示した、基盤1に設けた貫通孔1aにピン2を軸方向に移動自在に嵌挿し、基盤1とピン2の鍔状部5との間にスプリング6を介在させたものに限らず、各ピン2を流体圧シリンダや電動シリンダ等の直線駆動手段に連結し、各直線駆動手段を介して各ピン2を独立し

て直線移動させるように変更することができる。

[0018]

次に、本発明に係る乾式ブラスト洗浄における被洗浄物の除電方法の工程について、上述した図1に示した被洗浄物の除電装置を用いた場合を例に挙げて説明する。

[0019]

(1) 図1の(a)、(b)に示すように、被洗浄物Wを、その対向する両側 縁部を保持部材10の先端の溝状部10aに嵌合して保持しておく。

[0020]

他方、操作レバー14を図示水平位置にして移動枠9を固定枠11の反保持部材側に後退させることにより、除電ブロックEを基盤1と保持部材10間に介在されたスプリング8の弾発力によって各ピン2の接点3が被洗浄物Wから十分に離間した待機位置に後退させておく。

[0021]

なお、この待機位置においては、除電ブロックEの各ピン2は、基盤1と鍔状部5との間に介在されたスプリング6の弾発力により、ストッパ4が基盤1の反被洗浄物側面に当接している。

[0022]

(2)上記(1)ののち、図2に示すように、接触機構13のレバー14を回動させて図示しないカム機構やリンク機構等を介して移動枠9とともに除電ブロックEをスプリング8の弾発力に抗して被洗浄物Wに向かって前進(矢印方向へ直線移動)させる。すると、各ピン2の先端の接点3が被洗浄物Wの対向部位に当接し、当接した部位の凹凸部に対応して各ピン2毎にスプリング6の弾発力に抗して基盤1から被洗浄物W側へ突出する長さが独立して変化する。その結果、各ピン2の接点3はそれぞれ緩衝手段であるスプリング6の弾発力に相当する所定の接触圧力で被洗浄物Wに当接され、被洗浄物Wに当接された各ピン2を通して被洗浄物Wが接地された状態になる。

[0023]

すなわち、複数の接地された導電性を有するピン2を、被洗浄物Wの多点接触

させる。

[0024]

(3)上記(2)ののち、乾式ブラスト洗浄を開始すると、乾式ブラスト洗浄中に被洗浄物Wに発生する静電気が、各ピン2から基盤1を介してアース線12に流れて除電される。

[0025]

【発明の効果】

本発明は、上述のとおり構成されているので、次に記載するような効果を奏する。

[0026]

乾式ブラスト洗浄中に被洗浄物に発生する静電気を確実に除去することができるので、被洗浄物が静電気に対して脆弱な電子機器であっても、その電気特性に 害を及ぼすことなく乾式ブラスト洗浄を容易かつ安全に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

図1

一実施の形態による除電装置を示し、(a)は全体構成を示す説明図、(b)は主要部を示す模式部分断面図である。

【図2】

図1に示す除電装置の作動状態を示す説明図である。

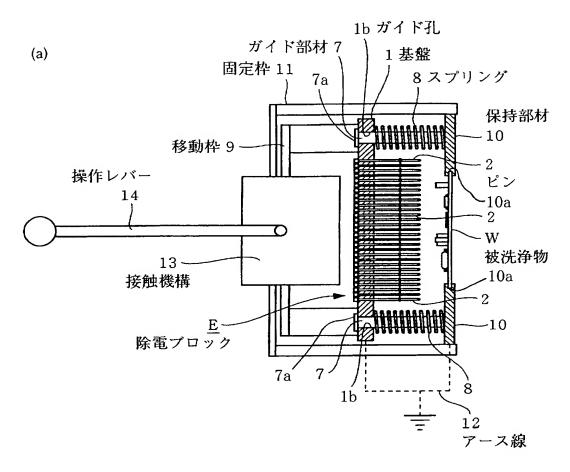
【符号の説明】

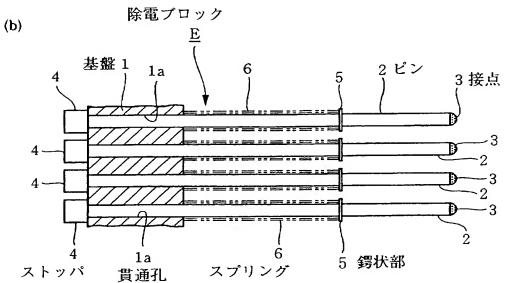
- 1 基盤
- 1 a 貫通孔
- 1 b ガイド孔
- 2 ピン
- 3 接点
- 4、7a ストッパ
- 5 鍔状部
- 6、8 スプリング
- 7 ガイド部材

- 9 移動枠
- 10 保持部材
- 10a 溝状部
- 11 固定枠
- 12 アース線
- 13 接触機構
- 14 操作レバー

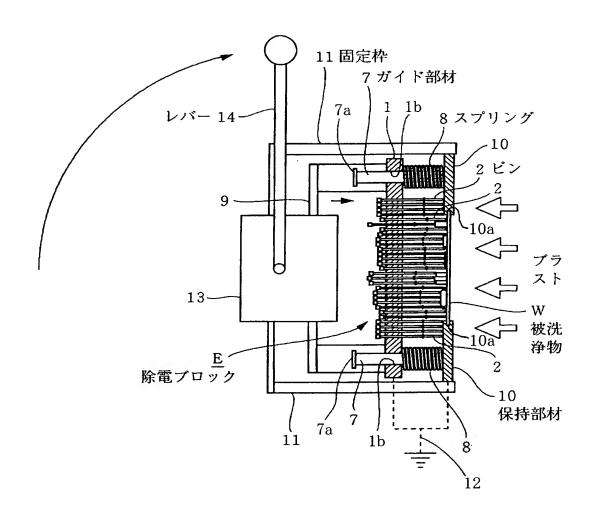
【書類名】 図面

【図1】





【図2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電子機器等の広範な被洗浄物の乾式ブラスト洗浄にあたり、被洗浄物に発生する静電気を簡単かつ確実に除去できるようにする。

【解決手段】 除電ブロックEは、アース線を介して接地された導電性を有する基盤1と、基盤1に設けられた複数の貫通孔1aにそれぞれ軸方向へ移動自在に嵌挿された導電性を有するピン2とを備えている。各ピン2は、基盤1と鍔状部5との間にスプリング6を介在させることにより常にストッパ4が基盤1の反被洗浄物側の面に当接した状態で待機するように付勢されている。接触機構13のレバー14を回動させると、除電ブロックEが被洗浄物Wに向かって前進して各ピン2の接点3が被洗浄物Wに当接し、当接した部位の凹凸部に対応して各ピン2の接点3が被洗浄物Wに当接し、当接した部位の凹凸部に対応して各ピン毎にスプリング6の弾発力に抗して基盤1から被洗浄物W側へ突出する長さが独立して変化して所定の接触圧力で当接し、静電気を除去することができる。

【選択図】 図1

特願2002-229380

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月30日 新規登録

住 所 氏 名 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

キヤノン株式会社